

Nabór kandydatów na STYPENDIUM NAUKOWE

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

Projekt NCN OPUS

*Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych
stopni utlenienia atomów metali*

Panel ST4

Przedmiotem badań są teoretyczne rozważania nad możliwością osiągnięcia nietypowych bardzo wysokich formalnych stopni utlenienia (rozebranie atomów aż do elektronów rdzenia) w wybranych azotkach, tlenkach i fluorkach metali przejściowych i lantanowców.

Kwalifikacje kandydatów:

- student 4 roku kierunków chemicznych, lub fizyki,
- b. dobra znajomość j. angielskiego
- znajomość systemu operacyjnego typu UNIX na poziomie co najmniej użytkownika
- umiejętność programowania w dowolnym języku,
- mile widziana znajomość programów do obliczeń kwantowo-chemicznych oraz metod chemii obliczeniowej i podstaw teorii chemii kwantowej,
- wysoka motywacja, systematyczność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole

Zgłoszenie powinno zawierać:

- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród
- listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień
- staże i praktyki zawodowe, inne osiągnięcia

Warunki zatrudnienia:

- realizacja i obrona pracy magisterskiej z tematu projektu
- 2 stypendia w wysokości od 500 do **2000 PLN miesięcznie, przez okres 2 lat**, uzależnione od kwalifikacji kandydatów.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres do godz. 24:00, piątek 24.11.2017:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2c, Pokój 5043
02-097 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres (proszę wpisać "Hi-Ox aplikacja" w tytule maila):

pawel.szarek@cent.uw.edu.pl

rozstrzygnięcie 31.11.2017 po rozmowach kwalifikacyjnych